

Inhalt

		Seite
<i>R. Feiertag</i>	Begrüßung und Einführung	1
<i>W. Arden</i>	Perspektiven und Grenzen der lichtoptischen Lithographie	3
<i>E. Aigner</i>	Stand und Zukunftsaussichten lichtoptisch hergestellter Fotomasken	19
<i>R. Kastmann</i>	Stand und Zukunftsaussichten elektronen-optisch hergestellter Fotomasken	31
<i>H. Feindt, V. Fuchs und J. Wienk</i>	Maskenvermessung höchster Genauigkeit	51
<i>H. Weigel und H. Wahlers</i>	Detektion von Submikrondefekten auf Fotomasken	75
<i>W. Maurer</i>	Holographische Defektinspektion	87
<i>U. Weigmann</i>	Reparatur von Röntgenmasken	105
<i>D. Sofronijevic</i>	Schlußwort und Ausblick	127